# DEVELOPMENT OF A HIGH AVERAGE POWER LASER GENERATING ELECTRON BEAM IN ILC FORMAT FOR KEK-STF\*

M. Kuriki<sup>†</sup>, H. Iijima, Hiroshima U., Higashi-hiroshima, Japan H. Hayano, Y. Honda, H. Sugiyama, J. Urakawa, KEK, Tskuba, Japan G. Isoyama, S. Kashiwagi<sup>‡</sup>, R. Kato, Osaka U., Suita, Japan E.Katin, E. Khazanov, V.Lozhkarev, G.Luchinin, A.Poteomkin, IAP/RAS, Nizhny-novgorod, Russia G.Shirkov, G. Trubnikov, JINR, Dubna, Russia

#### Abstract

Aim of Super-conducting Test Facility (STF) at KEK is demonstrating technologies for International Linear Collider(ILC). In STF, beam acceleration test is one of the most important goals, since precise RF control in the beam acceleration is essential for super-conducting accelerator. To provide ILC format beam for STF, we develop an electron source based on photo-cathode L-band RF gun. In this article, the laser system is described. The laser system consists from Yb fiber oscillator, macro-pulse profiler, Nd:YLF amplifier and Harmonic Generations. The laser system is initially developed at Institute for Applied Physics(IAP), Nizhny-Novgorod, Russia and moved to KEK-STF, Japan for the experiment. The laser system meets the basic ILC requirements; One macro-pulse contains 2439 micro pulses; The micro-pulse energy is  $1.9\mu$ J, which corresponds to 4.3nC assuming 1.0% quantum efficiency. We report the basic performance of the laser system.

KEK-STFにおける ILC 形式ビーム生成のための高平均出力レーザーの開発

#### 1. ILCとSTF

ILC は線形加速器による電子・陽電子衝突型加速器 であり, 超対称性粒子や Higgs 粒子の発見と研究等を 目指した将来計画である. 重心系エネルギーは 200-500GeV, 将来的には 1.0TeV まで拡張可能とし, ルミノ シティ2.0×10<sup>34</sup> cm<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup>を目指している<sup>[1]</sup>. 20世紀末 から各国の多くの研究所で同様の計画が推進されてきた が, ICFA(International Committee for Future Accelerator) は多くの計画を統合し,世界統一の計画として推進する ことを提唱した. 加速技術の統一をはかるべく ITRP (International Technology Recommendation Panel)<sup>[2]</sup>による 評価を行い, その答申をもとに超電導加速による世界 統一プロジェクト, ILC が発足した.

ILC はふたつの超電導線形加速器からなり, 各々は 31.5MV/mの加速勾配で電子と陽電子を高エネルギーま で加速する. 超電導加速器は 5Hz で運転され, その有効 パルス長はおよそ 0.97ms である. このひとつの RF パル スで 2625 バンチが加速される. これをマクロパルスと呼 ぶ. マクロパルスに対してバンチのことをマイクロパル スと呼ぶこともある. バンチ間隔は 369ns, 2.71MHz 繰 り返しである. これは超電導空洞の加速周波数 1.3GHz の 1/480に相当する. ひとつのバンチは 3.2nC の電荷を 持ち, マクロパルス内での平均ビーム電流は 8.7mA で ある.

STFの目的は ILCの超電導加速ユニットの実証である. 超電導加速器ではビーム負荷と入力 RF が完全に 平衡状態になければならないので、そのための RF 制御 が課題であり、実際のビーム加速試験が不可欠である. ILC の電子ビームは 80%以上のスピン偏極ビームであ り、GaAs/GaAsP 歪み超格子が光電陰極として使用され る<sup>[3][4]</sup>.他方,STFではスピン偏極は必ずしも必要ないので,光電陰極としてCsTe<sup>[5]</sup>を採用することとした.CsTeは量子効率の高さと比較的丈夫であることから現在ひろく使用されている.CsTe 陰極は 1.0% 程度の量子効率を-r月以上という長期の運転期間にわたり維持することができる<sup>[6]</sup>.

CsTe 光電陰極は光電効果による電子発生に紫外光を 必要とする. STFにおいては相対値で 3%以内という高い 安定性が要求されるため, Yb fibre laser を発振器として 使用することにした<sup>[7]</sup>. Yb fibre laser の出力を Nd:YLF レーザーで増幅し, その四倍高調波を非線型結晶によっ て生成し,紫外光のパルス列ををつくる. ILC で必要と なる 3.2nC というビームバンチ電荷を作るには,量子効 率 1%を仮定して 1.5  $\mu$ J というエネルギーがマイクロパ ルスあたりに必要となる. レーザーシステムの詳細につ いては次節で述べる.

STF の電子銃は L-band の RF 電子銃である. RF 電子銃は FEL のための電子源として開発されたが, 現在では様々な用途に広く使用されている <sup>[8][9]</sup>. STF では超電 導加速器と同期をとるために, DESY で FEL 用に開発された 1.3GHz L-band RF 電子銃 <sup>[10]</sup> を採用した. およそ 3.0MW の RF 入力で  $E_0 = 40.0MV/m$ を発生する.本空洞は米国のフェルミ国立研究所 FNAL で製作されたものである. 陰極には既述したように CsTe を使用している.CsTe カソードは脱着可能な Mo のプラグ上に別容器内で蒸着生成され, 真空容器内を輸送機構により大気に暴露されることなく電子銃に装填される.

### 2. LASER SYSTEM

本節では STF 電子銃用のレーザーシステムについて説 明する. 本システムは大きくわけて四つの部分からなる. Yb fibre oscillator(Pico-Second Master Oscillator, PMO), Macro-Pulse Profiler (MPP), Nd:YLF amplifier(YLFA), そ

<sup>\*</sup> Work supported by MEXT Quantum Beam Technology Program

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> corresponding author:mkuriki@hiroshima-u.ac.jp

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> current address: Tohoku Univ., Sendai, Japan

#### して Harmonic Generators (HG) である.

PMO は受動モードロックレーザーであり、その繰り 返し周波数は 40.625 MHz, マイクロパルス長はおよそ 10ps である. PMO は Yb fibre laser と共振器構造から なり, Yb fibre laser は 100mW の半導体レーザーで ポンプされている. 共振器構造をなす鏡のうち一枚に はモードロックによるパルス列生成のために SESAM (Semiconductor Saturable Absorber Mirror)が使用されて いる. この SESAM は線形移動ステージ上に置かれてお り、モードロック周期のおおまかな調整に使われ、その 調整幅は 63kHz である. 周期の微調整にはピエゾシリン ダーが使用される. ピエゾシリンダーとはピエゾ素子へ の印加電圧によりファイバー光路長が変化する素子であ り、これによる調整幅は 600Hz である. PMO で発生し たパルストレインはファイバー出力カプラーにより取 り出され, MPP ヘファイバー伝送される. PMO からの 出力はマイクロパルスが 40.625MHz で繰り返される準 連続波であり, 波長は 1050nm, 平均出力は 2.0mW, マイ クロパルスあたりのエネルギーは 50pJ である. PMO 出 力での安定度は数時間に 0.5%程度で, PLL(Phase Lock Loop) をかけない状態での繰り返し周波数の安定度は 120 Hz/hour である. 現在 PLL はまだ実装されていない が、この変動幅はピエゾシリンダーによる調整幅よりも 小さく、PLLによる同期が可能である.PLLは今年中の 実装を予定している.



図 1: MPP(Macro Pulse Profiler)の機能. (a) パルスの 間引き, (b) マクロパルス形成, そして (c) 振幅変調. 各々の図の左右が MPP の入力と出力を概念的に表して いる.

MPP(Macro Pulse Profiler)の機能を図1に概念的に示 す.同図の(a)に示されているように機能の第一はマイ クロパルスの繰り返しを PMOのそれである 40.628MHz から, STF でのバンチ繰り返しである 2.71MHz に変え ることにある.第二の機能は同図の(b)で示されている ように 0.9 ms というマクロパルス構造をつくり出すこ とにある. PMOの出力は準連続パルスであるが,その一 部を長さ 0.9ms で切り出すことでマクロパルス構造が つくり出される.そして第三の機能は同図の(c)で示さ れているように,マクロパルス構造内で振幅変調を行う ことである.これは次段の YLFA において生じてしまう マクロパルス内の振幅の変動をあらかじめ逆の変調をか けることにより抑制するためである.以上が MPP の 機能である. 図1では説明のために各々の機能が別々に 働くかのように説明しているが,実際には MPP は一組 の AO 変調素子とドライバーからなり,一つの変調素子 によりこの三つの機能を実現している. MPP 出力での マイクロパルスエネルギーは 10nJ 程度である.



図 2: 二つの Nd:YLF の増幅率曲線. 点線と破線が各々のアンプの増幅率をあらわしており,実線がその積である. 設計値である 30 の増幅率が 0.9ms にわたり得られている.

YLFA (YLF Amplifiers)の役割は 5Hz で繰り返される 長さ 0.9ms という長いマクロパルスにわたり,均一な増 幅を行うことである. 最終的に四倍高調波で必要とさ れるマイクロパルスエネルギーは 1.5µJ であるから,基 本波から四倍波への変換効率を15%程度と仮定すると YLFA 出力において ~ 10 μJ 程度のマイクロパルスエネ ルギーを実現しなくてはならない. MPP 出力が 10 nJ 程 度であるから, YLFA の増幅率は 10<sup>3</sup> 以上でなくてはな らない. YLFA はフラッシュランプによりポンプされる Nd:YLF レーザーを二台用いることとした. Nd:YLF の 径は5mmで、IAP/RAS 製作によるものである. 充分な増 幅率を得るために、この二台の Nd:YLF レーザーを各々 二回通過するような two-pass 配置とした. 図2は YLFA の増幅率の時間依存性, すなわちマクロパルス内におけ る変化をあらわしたものである. Nd:YLFの反転準位の 寿命は 500µs であり、マクロパルス長である 0.9 ms よ りも小さい. そのため反転準位の緩和による増幅率の 減少がマクロパルス内において生じてしまい,均一な増 幅が困難となる. その問題を解決するために, 図2で 示されているように YLFA では二台のアンプのタイミ ングとゲインを調整し、マクロパルスにわたる増幅率を なるべく一定とするようにした.これにより必要な増幅 率である一段あたり 30 の増幅率を実現しているが、そ れでも増幅率は大きな変動が残っている. この残った変 動を抑制するために前段の MPP においてマクロパルス 全体にわたる振幅変調を行い、YLFA 出力で平坦なマク ロパルスが得られるように最適化を行っている. 図3は 観測されたマクロパルス全体の振幅を表している (四倍 高調波). Nd:YLF が持つ増幅率変動が抑制され, 結果と して均一なマクロパルスが得られていることがわかる. 均一度は rms で 2.5%, マイクロパルスあたりのエネ ルギーは 11 μJ(基本波)である.

YLFA の出力は基本波である 1050nm の赤外光である から、CsTe での光電効果による電子発生のために UV 光



図 3: 四倍高調波におけるマクロパルス全体の振幅を横軸に時間軸をとり表示したもの. 均一度は rms で 2.5% である.



図 4: 基本波から二倍波(白丸)と四倍波(黒丸)各高調波 への変換効率を%であらわしたもの. 横軸は基本波のマ クロパルスエネルギーである.

に変換する必要がある. そのために非線型結晶による倍 波生成を二段用いている.様々な複屈折非線型結晶を比較 した結果<sup>[11]</sup>, KTPを SHG(Second Harmonic Generation) に, BBO を FHG(Fourth Harmonic Generation) に使用す ることとした.使用した KTPと BBO の結晶は各々厚み 7.5mm および 10.mm で, type II および typeI の位相整合 である. 図4は二倍波 (白丸) および四倍波 (黒丸) への 変換効率を基本波のマクロパルスエネルギーの関数と して表したものである. 全体の変換効率は最大で 30% 程度と予測されたが、25%という近い値が実験的に得ら れた.この時の四倍波でのマイクロパルスエネルギーは 1.9 µJ であり, STF で必要な 1.5µJ を上回る値が実現さ れた. 図5は四倍波のパワーをヒストグラムであらわし たもので、10分間にわたるデータを蓄積したものであ る. これより 10 分程度の時間にわたり rms で 2.4%程度 の安定度を持っていることがわかる.パワーの安定度は 3%以下が要求であるから、短時間における安定度は要求 を満たしていることが確認された.基本波および二倍波 について同様のデータを取得したところ,各々の安定度 は1.3%および2.8%であった. 二倍波のマイクロパルス 長は 8.5ps であった.

本システムはグループによる仕様決定の後,主にロシ アのニジニノブゴロドにあるロシア科学アカデミー応用



図 5: 四倍高調波のパワーをプロットしたもの. 10 分間 にわたり蓄積されたデータを用いており, 22.57±0.54 (2.4%)の安定度を示している.

物理研究所 (IAP/RAS) において開発が進められた. 2009 年の12月に日本およびモスクワ-ドゥブナの原子核共同 研究所 (JINR)の共同研究者立ち合いのもと基本性能の 確認が行われ, 2010年3月につくばの KEK-STFへと輸 送され, STFトンネル内のレーザーハット内に設置され た. KEK-STFにおいてもロシアで得られたものと同じ 性能が再現されている.

## 3. まとめ

KEK-STF のために ILC 形式のビームを発生させる レーザーシステムが, IAP/RAS, JINR, KEK, 大阪大学そ して広島大学の共同研究の成果として完成した. 開発さ れたシステムは STF 入射器用レーザーとしての要求基 本性能を全て満たしていることが確認された. 現在, シ ステムは外部と非同期であるが, PMO の信号と外部信 号との位相差をもとにピエゾシリンダーをドライブす ることで外部参照信号との同期をとることができる. こ の同期システムを今年中に実装することを予定してい る. STF は 2012 年にビームテストを予定しており, 本シ ステムの開発がほぼ予定通りに進んでいることを報告 する.

#### 参考文献

- [1] Reference Design Report, ILC-Report-2007-1 (2007)
- [2] ITRP recommendation (2004)
- [3] T. Nishitani et al., J. Appl. Phys. 97, 094907 (2005)
- [4] T. Maruyama et al., Appl. Phys. Lett. 85, 2640(2004)
- [5] E. Chevallay, et al., NIM A 340, 146-156 (1994)
- [6] N. Terunuma et al., NIM A 613, 1-8 (2010)
- [7] J. Limpert, Encyclopaedia of laser phy. and tech. (2010)
- [8] S. Kashiwagi et al., NIM A 455, 36-46 (2000)
- [9] K. Hirano et al. NIM A 560, 233-239 (2006)
- [10] B. Dwersteg, et al., NIM A 393, 93-95 (1997)
- [11] E.A.Khazanov and A.K.Poteomkin, "Laser system project", an internal memo (unpublished)